This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

		•			15		
					•		
	>						*
	9						
	<u> </u>					*	
9	-						
							t
Ĭ		?					
	* .						
	·		.es				ů,
				9		9	

(19) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

Offenlegungsschrift

₁₀ DE 3151080 A1

(51) Int. Cl. 3: H 04 Q 3/52 H 03 K 17/16

H 03 K 17/693



DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: P 31 51 080.9 23. 12. 81 Anmeldetag:

Offenlegungstag: 14. 7.83

(71) Anmelder:

Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH, 8500 Nürnberg, DE

72 Erfinder:

Endres, Walter, Ing.(grad.), 8500 Nürnberg, DE



Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Koppelfeldeinrichtung

Bei einer Koppelfeldeinrichtung mit Feldeffekttransistoren als Koppelelemente soll die Nebensprechdämpfung im Falle hoher Frequenzen verbessert werden. Hierfür ist in jedem Koppelfeld ein zweiter MOS-Feldeffekttransistor so geschaltet, daß die Source-Gatestreukapazitäten im gesperrten Zustand des Koppelelements als Blindwiderstände wirksam bleiben und mit einer Drain-Source-Teilkapazität einen kapazitiven Spannungsteiler bilden.

TE KA DE Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH 18.12.81 P 81519

--40--

Patentansprüche

- Koppelfeldeinrichtung mit Feldeffekttransistoren als Koppelelementen, wobei die Gate- und die Bulkanschlüsse der Feldeffekttransistoren wechselstrommäßig an Bezugspotential liegen und die Drain-Source-Strecken die durchschaltbaren Signalstrecken sind, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Koppelelement (5 bis 8) außer einem ersten Feldeffektzweiten Feldeffekttransistransistor (F1) einen tor (F2) aufweist, daß beide Feldeffekttransistoren MOS-Feldeffekttransistoren (F1, F2) sind, daß die Drain-Source-Strecks des zweiten Feldeffekttransistors (F2), dessen Gate- und Bulkanschlüsse wechselstrommäßig an Bezugspotential 🗘 liegen, in Reihe zur Drain-Source-Strecke des ersten Feldeffekttransistors (F1) geschaltet ist, so daß die Drain- und/oder Source-Gate-Teilkapazitäten (c_0 bzw. c_s) parallel liegen, und daß diese Teilkapapzitäten im gesperrten Zustand des Koppelelements (5 bis 8) zwischen dem Source- bzw. Drain-Verbindungspunkt der beiden Feldeffekttransistoren (F1, F2) und dem Bezugspotential $(oldsymbol{\perp})$ als Blindwiderstand wirksam gehalten sind und mit einer Drain-Source-Teilkapazität (C_1) des zweiten Feldeffekttransistors (F2) einen kapazitiven Spannungsteiler bilden.
 - 2. Koppelfeldeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Feldeffekttransistoren (F1, F2) an ihren Source-Anschlüssen (S) miteinander verbunden sind.

- <44'-

5

10

15

20

- 3. Koppelfeldeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den gemeinsamen Verbindungspunkt der beiden Feldeffekttransistoren und Bezugspotential (1) ein Kondensator (C2) geschaltet ist.
- 4. Koppelfeldeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß dem Kondensator (C2) ein Widerstand (R1) in Reihe geschaltet ist.

.3.

TE KA DE Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen GmbH 18.12.61 P 81519

Koppelfeldeinrichtung

Die Erfindung betrifft eine Koppelfeldeinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine derartige Koppelfeldeinrichtung ist in der DE-PS
19 22 382 beschrieben. Dort ist die durchschaltbare
Übertragungsstrecke von der Drain-Source-Strecke eines
einzigen Feldeffekttransistors gebildet. Die bei diesem
zwangsläufig vorhandenen Teilkapazitäten zwischen den
Elektroden werden durch eine zusätzliche Kapazität
unwirksam geschaltet, so daß auch bei hohen Frequenzen
eine gute Entkopplung zwischen Eingang und Ausgang des
Koppelelements erreicht wird. Um das kapazitive Nebensprechen zwischen durchgeschalteten Verbindungen möglichst
kleinzuhalten, sind Verstärker in den Eingangsleitungen
vorgesehen, die an ihrem Ausgang einen möglichst niedrigen Innenwiderstand haben.

.4·

Das Nebensprechen ist von der Teilkapazität der Drain-Source-Strecke abhängig, die den Widerstand des abgeschalteten Koppelelements bestimmt, obwohl diese Teilkapazität sehr klein ist. Durch besondere Abschirmmaßnahmen kann sie bis zu einem Wert von etwa 0,03 pF gesenkt werden. Trotzdem ergibt sich bei hohen Frequenzen, beispielsweise 20 MHz, eine Nebensprechdämpfung, die so niedrig ist, daß sich das Koppelelement bei breitbandigen Trägerfrequenzsystemen nicht einsetzen läßt.

Aus der DE-OS 26 54 269 ist eine Schaltungsanordnung mit drei Feldeffekttransistoren bekannt, wobei die Drain-Source-Strecken zweier Transistoren in Reihe geschaltet sind und der dritte Transistor als Quertransistor nach Masse schaltet. Eine derartige Schaltungsanordnung ist durch den dritten Feldeffekttransistor aufwendig und derzeit wegen der räumlichen Ausdehnung für hohe Frequenzen und ausreichender Nebensprechdämpfung nicht realisierbar.

Eine ähnliche Schaltung ist in Figur 2 der DE-AS
12 380 891 dargestellt. In Figur 1 dieser Auslegeschrift
verbindet ein (niederohmiger) Widerstand die Sourceund die Gateanschlüsse zweier Feldeffekttransistoren.
Der Einfluß der Teilkapazitäten soll damit im durchgeschalteten Zustand herabgesetzt werden, um eine höhere
Umschaltgeschwindigkeit sowie eine höhere Übertragungsfrequenz zu erzielen. Dies bewirkt allerdings eine
beträchtliche Dämpfung des Signals im durchgeschalteten
Koppelelement.

.5.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so zu gestalten, daß die Nebensprechdämpfung bei hohen Frequenzen deutlich verbessert ist.

5

Gelöst wird obige Aufgabe durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1.

Überraschend an der erfindungsgemäßen Schaltung ist, daß

mit nur zwei MOS-Feldeffekttransistoren sich eine wesentliche Verbesserung der Nebensprechdämpfung im Bereich
hoher Frequenzen ergibt. Dies wird durch Ausnutzung von
Teilkapazitäten zwischen den Elektroden erreicht, welche
beim Stand der Technik unterdrückt werden.

15

Ausgestaltungen der Erfindungen ergeben sich aus der folgenden Beschreibung. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 ein Koppelfeld,

20

- Figur 2 ein Koppelelement des Koppelfelds,
- Figur 3 ein Ersatzschaltbild des durchgeschalteten Koppelelements nach Figur 2,

25

Figur 4 ein Ersatzschaltbild der Serienschaltung eines gesperrten und eines durchgeschalteten Koppel-elements nach Figur 2,

- H -

- Figur 5 ein Ersatzschaltbild für den Fall nur eines Feldeffekttransistors als Koppelelement und
- Figur 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Koppelelements.

Im unsymmetrischen Koppelfeld nach Figur 1 sind zur Verbindung der vier Schienen 1 bis 4 vier erdunsymmetrische Koppelelemente 5 bis 8 vorgesehen. An einem Eingang E1 der Schiene 1 liegt eine Spannungsquelle Q1. An einem Eingang E2 der Schiene 2 liegt eine Spannungsquelle Q1. An einem Eingang E2 der Schiene 2 liegt eine Spannungsquelle Q2. Beide Spannungsquellen Q1 und Q2 haben einen Innenwiderstand Ri von etwa O Ω. Am Ausgang A1 der Schiene 3 liegt ein Verstärker V1. Am Ausgang A2 der Schiene 4 liegt ein Verstärker V2. Der Eingangswiderstand Re der Verstärker V1 und V2 ist wesentlich größer als der Durchschaltwiderstand Rd der Koppelelemente 5 bis 8.

Jedes Koppelelement 5 bis 8 weist zwei MOS-Feldeffekttransistoren F1 und F2 auf (Figur 2). Der DrainAnschluß D des Feldeffekttransistors F1 liegt bei den
Koppelelementen 5 und 6 an der Schiene 1 und bei den
Koppelelementen 7 und 8 an der Schiene 2. Der Drainanschluß D des Feldeffekttransistors F2 ist bei den
Koppelelementen 5 und 7 mit der Schiene 4 und bei den
Koppelelementen 6 und 8 mit der Schiene 3 verbunden.
Die Source-Anschlüsse S der Feldeffekttransistoren F1

25

und F2 sind meiteinander verbunden, so daß die DrainSource-Strecken der beiden Feldeffekttransistoren F1 und
F2 zwischen den Schienen in Reihe liegen. Die GateAnschlüsse G der Feldeffekttransistoren F1 und F2 sind
mit einem Steuereingang St und über eine Kapazität (d.h.
wechselstrommäßig) mit dem Bezugspotential verbunden. Die BulkAnschlüsse B der Feldeffekttransistoren F1 und F2 liegen
an deren Gate-Anschlüssen G. Die die Koppelelemente 5 bis
8 jeweils am Eingang St ein- und ausschaltende Schaltung
ist nicht näher dargestellt.

Zur Beschreibung der Funktionsweise der Schaltung nach Figur 2 ist angenommen, daß die Koppelelemente 6 und 7 durchgeschaltet und die Koppelelemente 5 und 8 gesperrt sind. Es ist damit der Eingang E1 mit dem Ausgang A1 und der Eingang E2 mit dem Ausgang A2 verbunden. Damit ist ein Weg I und ein Weg II geschaltet.

Es tritt dabei Nebensprechen insbesondere über das Kop20 pelelement 8 vom Weg II auf den Weg I auf. Strichliert
ist in Figur 1 dieser Nebensprechweg II/I angedeutet.

Figur 4 zeigt das Ersatzschaltbild des Nebensprechwegs II/I mit den bei höheren Signalfrequenzen wirksamen Teilkapazitäten der Feldeffekttransistoren F1 und F2. An den Drainanschlüssen D sind Teilkapazitäten $\mathbf{C}_{\mathbf{D}}$ und an den Source-Anschlüssen sind Teilkapazitäten $\mathbf{C}_{\mathbf{S}}$ wirksam. Zwischen den Drain- und Sourceanschlüssen treten Teilkapazitäten $\mathbf{C}_{\mathbf{1}}$. Diese Teilkapazitäten sind in Figur 4 lediglich bei den Feldeffekttransistoren F1 und F2 des gesperrten Koppelelements 8 dargestellt, das durch die Teilkapazitäten und die

-6-

5

10

25

hochohmigen Sperrwiderstände R_{aus} insgesamt den komplexen Sperrwiderstand bildet. Beim durchgeschalteten Koppelelement 6 sind die entsprechenden Teilkapazitäten in Figur 4 nicht dargestellt, da sie sich praktisch nicht auswirken. Es sind lediglich die niederohmigen Durchschaltwiderstände R_{ein} (Rd = $2R_{ein}$) der beiden Feldefekttransistoren F1 und F2 gezeigt. Figur 3 zeigt die Teilkapazitäten eines durchgeschalteten Koppelelements.

10

20

Für die Nebensprechdämpfung a_N

gilt am Spannungsteiler, wie er in Figur 5 mit komplexen Widerständen Z_{aus} und Z_{ein} dargestellt ist:

$$_{15}$$
 $_{N}$ = 20 $_{1g}$ $\left| U_{1} / U_{2} \right| \approx 20 ~_{1g}$ $\left| Z_{aus} / Z_{ein} \right|$ in dB.

Wie Figur 4 zu entnehmen, ergeben sich bei der Ersatzschaltung zwei Spannungsteiler, nämlich zwischen den Spannungen U_1 und U_2 ' einerseits und den Spannungen U_2 ' und U_2 andererseits. Dementsprechend addieren sich die logarithmischen Dämpfungswerte dieser beiden Spannungsteiler, so daß sich für die Nebensprechdämpfung a_{N4} im Falle der Figur 4 ergibt:

25
$$a_{N4} = 20 \text{ lg} \left| \begin{array}{c|c} U_1 & U_2 \\ \hline \end{array} \right| + 20 \text{ lg} \left| \begin{array}{c|c} U_2 & U_2 \\ \hline \end{array} \right|$$

$$\approx 20 \text{ lg} \left| \begin{array}{c|c} 2 & CS \\ \hline C1 \\ \hline \end{array} \right| + 20 \text{ lg} \left| \begin{array}{c|c} \frac{1}{2R_{\text{ein}}} & C_1 \\ \hline \end{array} \right| \text{ in dB,}$$

wobei es sich bei letztgenannter Beziehung um eine 30 Formulierung für hohe Frequenzen, beispielsweise 20 MHz,

. G.

handelt, in der zu vernachlässigende Schaltelementefunktionen eliminiert sind.

Ein MOS-Feldeffekttransistor Typ B5V 81 weist nach
Datenblatt bei 1 MHz folgende Werte auf

$$C_{SG} \le 0,5 \text{ pF}$$
 $R_{ein} = 40 \Omega$
 $C_{DG} \le 1,2 \text{ pF}$ $R_{aus} = 100 \text{ M}\Omega$
 $C_{GB} \le 5 \text{ pF}$

In einer praktisch aufgebauten Schaltung ergeben sich unter Verwendung von MOS-Feldeffekttransistoren des genannten Typs bei 20 MHz Kapazitätswerte:

 $^{\rm C}_{\rm 1}$ \approx 0,03 pF, $^{\rm C}_{\rm S}$ \approx 3 pF, welche-durch den Schaltungsaufbau bedingt - größer als die Kapazität $^{\rm C}_{\rm SG}$ ist.

Aus diesen Kapazitätswerten ergibt sich unter Berücksichtigung obiger Formel bei 20 MHz eine Nebensprechdämpfung $a_{\rm N4}$ von etwa 112 dB.

Vergleicht man diesen Wert mit der Nebensprechdämpfung, die dann aufträte, wenn das Koppelelement nur einen MOS-Feldeffekttransistor aufwiese, dann ergibt sich, daß dann nur mit einer Nebensprechdämpfung anton etwa 76 dB zu rechnen wäre. Dies ist darauf zurückzuführen, daß im letztgenannten Fall die Teilkapazität Cs praktisch ohne Einfluß auf die Nebensprechdämpfung bleibt. Die Neben-

- 8 -

15

20 . . .

· 11.

sprechdämpfung a würde in diesem Fall, in dem das Koppelelement nur einen Feldeffekttransistor aufweist, sich ergeben aus:

5
$$a_{N1} \approx 20 \text{ lg} \quad \frac{1}{R_{\text{ein}} \omega c_1}$$
 in dB,

wobei offensichtlich der erste Summenteil von $a_{N\,4}$, in den die Teilkapazitäten C_1 und $2C_S$ eingehen, nicht auftritt.

10

15

Damit ist mit nur zwei MOS-Feldeffekttransistoren je
Koppelelement ein Koppelfeld geschaffen, das sich zur
Durchschaltung von breitbandigen Signalen mit hoher
Nebensprechdämpfung eignet. Selbst bei Frequenzen von
36 MHz und darüber wird durch die erfindungsgemäße Schaltung noch eine wesentliche Verbesserung der Nebensprechdämpfung gegenüber nur einem Feldeffekttransistor je
Koppelelement erreicht.

20 Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zusammengefaßt:

			1 FET	2 FET	Verbesserung
a _N	bei	20 MHz	76 dB	112 dB	. 36 dB
a _N	bei	36 MHz	73 dB	109 dB	36 dB

25

In Weiterbildung der Erfindung kann es - zur Verbesserung des Sperrverhaltens bei niedrigeren Frequenzen - zweckmäßig sein, parallel zu der Parallelschaltung der

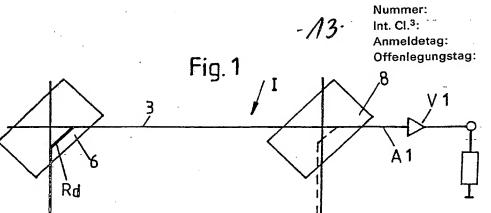
·11· - - 9- -

Teilkapazitäten C_S einen zusätzlichen Kondensator C2, oder eine Kondensator-Widerstandskombination C2, R1 vorzusehen. Allerdings ergibt sich hierbei eine Beeinflussung des Frequenzganges des durchgeschalteten Koppelelements (vgl. Figur 3), die beachtet werden muß. In Figur 6 ist eine solche Schaltung dargestellt.

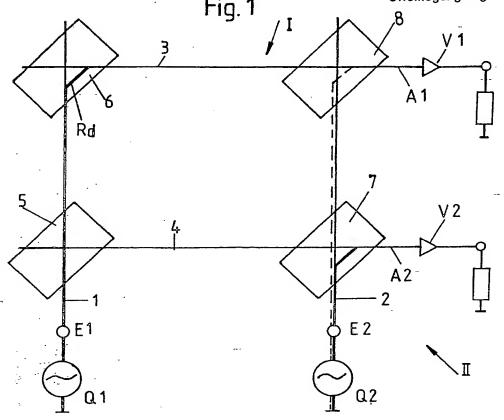
In obigem Ausführungsbeispiel sind die Source-Anschlüsse Szusammengeschaltet. In anderer Ausführung der Erfindung können statt dessen die Drain-Anschlüsse aneinander liegen, wobei dann die für die Verbesserung der Nebensprechdämpfung entscheidenden Kapazitäten die Kapazitäten Cp. sind.

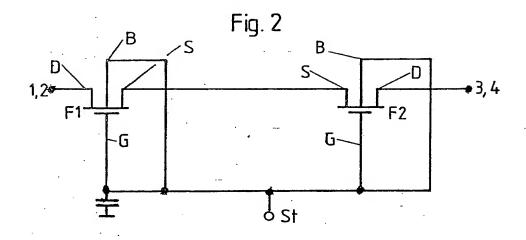
Es ist auch möglich, den Drain-Anschluß D des einen Feldeffekttransistors mit dem Source-Anschluß des anderen Feldeffekttransistors zu verbinden. Für die Verbesserung der Nebensprechdämpfung ist dann die Kapazität CD des einen Feldeffekttransistors sowie die Kapazität CS des anderen wirksam. Die Polung der Feldeffekttransistoren F1 und F2 kann also den Bedürfnissen des jeweiligen Einsatzfalles entsprechend gewählt werden. Es ist jedoch zu beachten, daß sich die gewählte Schaltung der Teilkapazitäten CS bzw. CD auf den Frequenzgang im Einschaltzustand auswirkt.

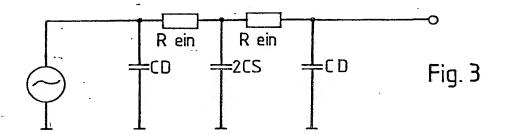
- <10-- --



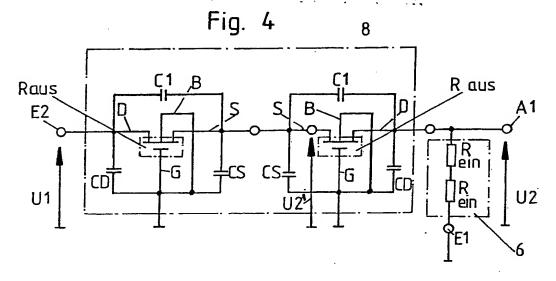
31 51 080 H 04 Q. 3/52 23. Dezember 1981 14. Juli 1983

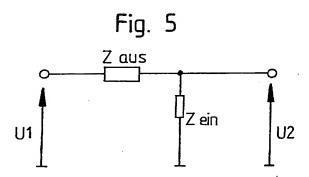


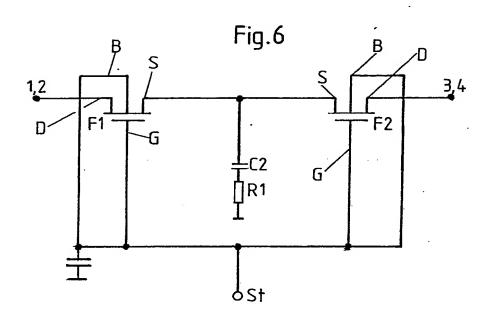




THIS PACK BLANK USPRO







THIS PAGE BLANK (USPTO)